

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成20年5月29日(2008.5.29)

【公開番号】特開2006-319201(P2006-319201A)

【公開日】平成18年11月24日(2006.11.24)

【年通号数】公開・登録公報2006-046

【出願番号】特願2005-141555(P2005-141555)

【国際特許分類】

H 01 L 21/31 (2006.01)

H 01 L 21/22 (2006.01)

H 01 L 21/324 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/31 B

H 01 L 21/22 5 1 1 A

H 01 L 21/22 5 1 1 S

H 01 L 21/324 R

H 01 L 21/324 W

【手続補正書】

【提出日】平成20年4月14日(2008.4.14)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

複数枚の基板を保持した基板保持体を収容して複数枚の基板を処理する処理室と、前記処理室周りに設置されて前記基板を加熱するヒータユニットと、

前記処理室内に収容された前記基板保持体の基板保持領域よりも高い位置に噴出口が位置するように配置されており、この噴出口が前記処理室の天井に向けて冷却ガスを流すよう開口されている冷却ガス供給手段と、

この冷却ガス供給手段と前記基板を挟んで対向する位置に、前記処理室内に収容された少なくとも前記ポートの基板載置領域に噴出孔が位置するように配置されており、この噴出孔は前記基板の正面に対して水平方向に冷却ガスを流すよう開口されている冷却ガス供給具と、前記処理室の下部に配置された排気口によって前記処理室を排気する排気手段と、

を備えていることを特徴とする基板処理装置。

【請求項2】

処理室内に複数枚の基板を保持した基板保持体を収容して前記処理室周りに設置されたヒータユニットで前記基板を加熱する工程と、前記基板保持体の基板保持領域よりも高い位置に噴出口が位置するように配置されている冷却ガス供給手段の噴出口から前記処理室の天井に向けて冷却ガスを流し、この冷却ガス供給手段と前記基板を挟んで対向する位置に、前記処理室内に収容された少なくとも前記ポートの基板載置領域に噴出孔が位置するように配置されている冷却ガス供給具の噴出孔から前記基板の正面に対して水平方向に冷却ガスを流し、前記処理室の下部に配置された排気口によって前記処理室を排気する工程と、

を有することを特徴とするICの製造方法。